СИНТЕЗ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ОКСИДУ ZrO₂–SiO₂, ДОПОВАНОГО ЙОНАМИ Sn (IV)

С. В. ПРУДІУС¹, Н. Л. ГЕС¹, О. І. ІНЬШИНА¹, О. Ю. ХИЖУН²

¹ Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України, Київ;
² Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України, Київ

Змішані потрійні ZrO₂–SiO₂–SnO₂ оксиди синтезовано золь-гель методом за атомного співвідношення компонентів Zr:Si:Sn = 1:2:x, де x = 0,1+4,0. Методами термогравіметрії та рентгенофазового аналізу встановлено, що в зразках, в яких $x \le 2$, висока гомогенність розподілу катіонів Sn⁴⁺ (x = 4). З подальшим збільшенням їх вмісту утворюється окрема фаза діоксиду олова, яка відповідає тетрагональній кристалічній структурі типу рутилу. Виявлено, що з введенням йонів олова в матрицю оксидів ZrO₂–SiO₂ кислотність зразків також збільшується. Зокрема, максимальна сила кислотних центрів (H_0) зростає з –11,35 для ZrSi₂ до –14,52 за переходу від ZrSi₂Sn_{0,4} до ZrSi₂Sn. У РФ-спектрах високоенергетичні зсуви Zr 3d_{5/2}- і Sn 3d_{5/2}-рівнів вказують на зміщення електронної густини від атомів цирконію та олова до атомів кремнію. Зафіксовано октаедрично та тетраедрично координовані катіони Sn⁴⁺ на поверхні зразків ZrSi₂Sn_x, які відносять до бренстедівських та льюїсівських кислотних центрів. Центрами Бренстеда можуть бути місткові –ОН групи на катіонах ^{VIII}Zr⁴⁺ та ^{IV}Sn⁴⁺, а Льюїса – координаційно ненасичені центри цирконію та олова.

Ключові слова: потрійний оксид, діоксид олова, ZrO₂–SiO₂, сила кислотних центрів, суперкислота.

Mixed ZrO_2 -SiO $_2$ -SiO $_2$ -SiO $_2$ oxides have been synthesized by sol-gel method with atomic ratios of components Zr:Si:Sn = 1:2:x, were $x = 0.1 \div 4.0$. Using thermogravimetric and XRD analysis it is shown that for samples with $x \le 2$ high homogeneity of Sn^{4+} (x = 4) cation distribution is observed. Further increase of their content leads to the formation of a separate phase of tin dioxide, which corresponds to tetragonal crystal structure of the rutile type. It is shown that introduction of tin ions in ZrO_2 -SiO $_2$ matrix leads to the increase in acidity of the obtained samples, too. Therefore, maximal strength of acid sites increases from -11.35 for ZrSi_2 to -14.52 for $\text{ZrSi}_2\text{Sn}_{.4}$ and ZrSi_2Sn . In XPS spectra, high energy shifts of Zr $3d_{5/2}$ and Sn $3d_{5/2}$ core levels indicate the shift of electron density from zirconium and tin atoms to silica atoms. The presence of octahedral and tetrahedral coordinated Sn⁴⁺ on the surface of the ZrSi_2Sn_x samples, which refers to Brönsted and Lewis acid sites, is observed. The bridging -OH groups on ^{VIII}Zr⁴⁺ and ^{IV}Sn⁴⁺ cations could be Bronsted sites and coordinated-unsaturated zirconium and tin cations are Lewis sites.

Keywords: ternary oxide, tin dioxide, ZrO_2 -SiO₂, acid sites strength, superacid.

Вступ. Змішані системи на основі диоксидів цирконію і кремнію все частіше застосовують як селективні сорбенти, йонообмінні матеріали і каталізатори для багатьох реакцій [1–3]. Умови синтезу SiO_2 – ZrO_2 оксиду залежать від кислотноосновних властивостей його поверхні, структурних особливостей і можливості подальшого використання в сорбції та каталізі [4–6]. Згідно з працею [6], під час синтезу ZrO_2 –SiO₂ з допомогою золь-гель технології можна одержувати поруваті матеріали з однорідним розподілом компонентів на атомарному рівні за співвідношення Zr:Si = 1:2. При цьому кількість кислотних центрів у ZrO_2 –SiO₂ зразках

Контактна особа: С. В. ПРУДІУС, e-mail: svitprud@gmail.com

максимальна [4–6] та спостерігається висока селективність цільових продуктів, наприклад, у реакціях ацилювання, переестерифікації метил-трет-бутилового естеру з етанолом, а також крекінгу вакуумного газойлю [7–9].

Модифікування бінарного SiO_2 –ZrO₂ оксиду іншими оксидами металів, здатними стабілізувати необхідну структуру, призводить до утворення нових матеріалів з оптимальними фізико-хімічними характеристиками і донорно-акцепторними властивостями. Зокрема, оксид церію у бінарній системі ZrO_2 –SiO₂ стабілізує формування тетрагональної фази ZrO₂ та поліпшує механічні властивості системи CeO₂–ZrO₂–SiO₂ [10]. Золь-гель методом синтезували [11] плівки потрійного змішаного оксиду TiO₂–ZrO₂–SiO₂ (21:9:70), каталітична активність яких зростала під час фотовідновлення Cr(VI) до Cr(III) порівняно з бінарною системою ZrO₂–SiO₂.

Недавно синтезовано потрійний суперкислотний $ZrO_2-SiO_2-Al_2O_3$ оксид, який проявив високу активність під час олігомеризації тетрагідрофурану при 40°C [12]. Синтезовано також потрійний сильнокислотний $ZrO_2-SiO_2-SnO_2$ оксид, який ефективно каталізує реакцію ацилювання толуолу оцтовим ангідридом при 150°C у проточному реакторі [13]. Проте мало вивчений взаємовплив компонентів на текстурні та структурні перетворення в оксидній системі ZrO_2-SiO_2 зі збільшенням вмісту катіонів олова. Також зацікавлюють дослідження їх стану в оксидній матриці ZrO_2-SiO_2 та вплив на концентрацію, тип та силу кислотних центрів у потрійному оксиді $ZrO_2-SiO_2-SiO_2$.

Тому нижче синтезовано потрійний змішаний ZrO₂–SiO₂–SnO₂ оксид та вивчено вплив катіонів олова на його текстурні, структурні та кислотні властивості.

Експериментальна частина. Серію оксидних зразків ZrO_2 –SiO₂–SnO₂ (атомне співвідношення Zr:Si:Sn = 1:2:x, де $x = 0,1\div4,0$) синтезували золь-гель методом. Як вихідні речовини використовували октагідрат оксихлориду цирконію (ZrOCl₂·8H₂O), тетраетоксісилан (TEOC), пентагідрат хлорид олова (SnCl₄·5H₂O) та карбамід ((NH₂)₂CO). Для попереднього гідролізу TEOC змішували з водноетанольним розчином за співвідношення TEOC:C₂H₅OH:H₂O = 15:8:77 mass%, при цьому значення pH ~ 6...7 регулювали, використовуючи 1М розчин HNO₃. Одержаний розчин додавали до водного розчину оксихлориду цирконію та хлориду олова. Щоб запобігти швидкому осадженню гідроксидів металів, у розчин додавали трикратний надлишок карбаміду та витримували дві доби при 93°C. Утворені ксерогелі промивали водою, висушували при 120°C та прожарювали 2 h при 750°C. Зразки ZrO₂–SiO₂–SnO₂ позначали як ZrSi₂Sn_x, де x – атомне співвідношення Sn⁴⁺i Zr⁴⁺ при Si⁴⁺/Zr⁴⁺ = 2.

Термічні дослідження здійснювали на серійному дериватографі Q-1500D (Угорщина) в інтервалі 290...1270 К, використовуючи платиновий тигель. Швидкість нагрівання зразків 10 К · min⁻¹. Їх рентгенограми реєстрували на дифрактрометрі ДРОН-4-07 у відфільтрованому нікелем Си K_{α} -випромінюванні за геометрії зйомки за Бреггом–Брентано в інтервалі 10...85°. Середній розмір кристалітів оксиду олова визначали за рівнянням Шеррера відносно найінтенсивнішого піка. Ізотерми адсорбції-десорбції азоту одержали з допомогою приладу Quantachrome Nova 2200e Surface Area and Pore Size Analyser. Методом трансмісійної електронної мікроскопії (ТЕМ) вивчали структуру та розмір частинок зразків на обладнанні JEM-1200 EX (JEOL, Японія) за пришвидшувальної напруги 80 kW, використовуючи цифрову фотокамеру Gatan.

Спектри відбиття (UV-Vis) зразків досліджували у повітрі, вживаючи як еталон BaSO₄, в діапазоні 200...700 nm спектрофотометром Shimadzu UV-2450. Рентгенівські фотоелектронні (РФ) спектри отримали за допомогою приладу UHV-Analysis-System (SPECS, Німеччина), обладнаного напівсферичним аналізатором РНОІВОЅ 150 (використовували рентгенівське MgK_{α} -випромінювання з $E = 1253,6 \text{ eV}, P_{\text{max}} = 100 \text{ W}$). Енергетичну шкалу спектрометра калібрували, застосовуючи еталонні зразки зі золота і міді [14]. Ефекти поверхневого заряду зразків враховували за результатами вимірів енергії зв'язку внутрішніх C1s-електронів від вуглеводневих адсорбатів (її значення приймали рівним 284,6 eV) [15]. Для порівняння одержали також РФ-спектри внутрішніх електронів у вихідних зразках ZrO₂–SiO₂, а також ZrO₂, SiO₂ і SnO₂. Реконструювали РФ-спектри, розкладаючи їх на компоненти за допомогою програми OriginPro 2019 у додатку Peak Deconvolution (версія 1.5). Під час побудови спектрів використовували пропорційну базову лінію (алгоритм Ширлі) та симетричний профіль піків компонентів з апроксимацією за функціями Гаусса та Лоренца (співвідношення функцій 70:30).

Загальну кількість кислотних центрів отримали методом зворотного титрування за допомогою розчину н-бутиламіну в циклогексані в присутності індикатора – бромтимолового синього. Силу кислотних центрів та розподіл зразків за нею визначали за стандартною методикою, застосовуючи 0,1% розчин у циклогексані відповідних індикаторів Гамметта [16]. Активність зразків оцінювали в тестовій реакції перетворення 2-метил–3-бутин–2-олу (МБОН) за відомою методикою [17].

Результати та обговорення. Склад та текстурні характеристики синтезованих зразків наведено в табл. 1. Відомо, що зразок ZrSi₂ є аморфним до 950°С [18]. На рис. 1 подано результати дослідження системи ZrSi₂Sn_x за допомогою термогравіметричного аналізу і побудовано інтегральну, диференціальну і диференціально-термічну криві. Як бачимо, за $x \le 2$ кристалізація діоксидів відсутня до 1000°С, що вказує на суттєву гомогенність системи. подальше збільшення вмісту Sn⁴⁺ (x = 4) у зразку призводить до кристалізації SnO₂, яка починається при 500°С.

Усім зразкам притаманна високорозвинена поверхня (290...360 m²/g), яка поступово зменшується зі збільшенням кількості діоксиду олова. Для зраз-



Рис. 1. Інтегральні (1), диференціальні (2) та диференціально-термічні (3) криві зразка ZrSi₂Sn₄.

Fig. 1. Integral (1), differential (2) and differential-thermal (3) curves of the ZrSi₂Sn₄ sample.

ків ZrSi₂Sn_x, де $x \le 2$, середній діаметр пор змінюється незначно, тоді як для зразка ZrSi₂Sn₄ – різко збільшується (табл. 1). Криві розподілу пор за розміром (рис. 2), одержані за ізотермою десорбції методом DFT (функціональної теорії щільності), для зразків ZrSi₂Sn₄ та SnO₂ подібні. Це може свідчити про формування окремої фази діоксиду олова в матриці ZrSi₂.

Наведено (рис. 3) дифрактограми зразків $ZrSi_2Sn_x$ з різними атомними співвідношеннями, на який інтенсивність дифузних гало при $2\theta = 30^{\circ}$ та 51° , яка пов'язана з аморфною структурою ZrO_2 –SiO₂ матриці, зменшується, можливо, внаслідок збільшення вмісту аморфного оксиду олова. Відсутність вузьких піків, властивих зразкам діоксиду олова, де $x \le 2$, вказує на його високу дисперсність на поверхні чи в об'ємі матриці ZrO_2 –SiO₂, що збігається з результатами термогравіметричного аналізу. На дифрактограмі зразка $ZrSi_2Sn_4$ присутні характерні піки (рис. 3), які відповідають тетрагональній кристалічній структурі типу рутилу SnO_2 [19] зі середнім розміром кристалітів $d_{cr} = 6$ nm. Дослідження мікроструктури зразків за допомогою TEM (рис. 4) виявили, що частинки подвійного оксиду $ZrSi_2$ близькі за формою до сферичної зі середнім розміром 3...4 nm, який з додаванням йонів олова поступово зростає до 8...12 nm для потрійного оксиду $ZrSi_2Sn_4$.

Зразок	Атомне співвідно- шення Zr:Si:Sn	Питома площа поверхні <i>S</i> , m ² /g	Об'єм пор <i>V</i> , cm ³ /g	Середній діаметр пор <i>d</i> , nm	Фазовий склад	Концен- трація кислот- них центрів, [HB], mmole/g	Макси- мальна сила кислот- них центрів, <i>H</i> _{0max}
ZrSi ₂	1:2:0,0	360	0,3	3,0	Аморфний	1,7	-11,35
ZrSi ₂ Sn _{0,1}	1:2:0,1	360	0,2	2,5	Аморфний	1,4	-13,75
$ZrSi_2Sn_{0,4}$	1:2:0,4	340	0,2	2,4	Аморфний	1,5	-14,52
ZrSi ₂ Sn ₁	1:2:1,0	300	0,2	2,5	Аморфний	1,4	-13,75
ZrSi ₂ Sn ₂	1:2:2,0	240	0,2	2,6	Аморфний	1,0	-12,44
ZrSi ₂ Sn ₄	1:2:4,0	205	0,2	3,8	Крист. SnO ₂ <i>d</i> _{cr} =6 nm / аморфний	0,9	-8,2

Таблиця 1. Склад, текстурні та кислотні характеристики ZrO2-SiO2-SnO2 зразків



Рис. 2. Розподіл DFT за розмірами пор зразків SnO₂ та ZrSi₂Sn_x, кальцинованих при 750°C: 1 - x = 0,1; 2 - 0,4; 3 - 1,0; 4 - 2,0; 5 - 4,0.

Fig. 2. DFT pore size distribution of SnO₂ and ZrSi₂Sn_x samples, calcined at 750°C: 1 - x = 0.1; 2 - 0.4; 3 - 1.0; 4 - 2.0; 5 - 4.0.

Рис. 3. Дифрактограми зразків ZrSi₂Sn_x, кальцинованих при 750°C: l - x = 4,0; 2 - 0,1; 3 - 0,4; 4 - 1,0; 5 - 2,0.

Fig. 3. XRD patterns of ZrSi_2Sn_x samples, calcinated at 750°C: l - x = 4.0; 2 - 0.1; 3 - 0.4; 4 - 1.0; 5 - 2.0.

З введенням йонів олова в матрицю ZrO_2 –SiO₂ збільшується кислотність зразків (табл. 1). За розподілом кислотних центрів за силою на поверхні зразка $ZrSi_2Sn_{0,4}$ (рис. 5) виявили ~10% суперкислотних (-13,16 $\ge H_0 \ge$ -14,52) та ~40% кислотних центрів меншої сили (-8,2 $\ge H_0 \ge$ -11,35). Для порівняння, поверхня зразка $ZrSi_2$ містить ~45% кислотних центрів з максимальною силою -8,2 $\ge H_0 \ge$ -11,35.

Такий їх розподіл корелює з активністю ZrO_2 –SiO $_2$ -SnO $_2$ зразків у реакції дегідратації 2-метил–3-бутин–2-олу (МБОН, 69 а.о.м.) до 3-метил–3-бутен–1-іну (Мьупе, 66 а.о.м.) та ізомеризації МБОН у 3-метил–2-бутен–1-аль (Prenal, 84 а.о.м.). Крива швидкості утворення Мьупе (рис. 6) має широке гало в області 70°С, яке, імовірно, обумовлено центрами з максимальною силою –8,2 $\ge H_0 \ge$ –12,14 [5]. Для ізомеризації МБОН в Prenal потрібні сильніші кислотні центри [5]. Наприклад, для WO₃–ZrO₂ зразка ($H_0 \ge$ –14,52) пік Prenal утворюється при 110°С [5], а для зразка ZrSi₂Sn_{0.4} – при 110...120°С (рис. 6).



Рис. 4. ТЕМ зображення ZrSi₂ (*a*), ZrSi₂Sn_{0,4} (*b*) та ZrSi₂Sn₄ (*c*).

Fig. 4. TEM images of ZrSi₂ (a), ZrSi₂Sn_{0.4} (b) and ZrSi₂Sn₄ (c).

За результатами електронної спектроскопії дифузного відбиття визначили стан катіонів олова Sn⁴⁺ в оксидній матриці, які можуть знаходитись у трьох типах координаційного оточення з відповідними спектроскопічними характеристиками: ізольовані тетраедрично (207 nm) та октаедрично (224 nm) координовані йони Sn⁴⁺, а також гексакоординовані (280 nm), які утворюють полімерні кластери SnO₆, наприклад, у структурі SnO₂ [19].



Рис. 5. Розподіл кислотних центрів за силою для оксидів $ZrSi_2Sn_{0,4}$ та $ZrSi_2:$ $\blacksquare - ZrO_2 - SiO_2; \Box - ZrO_2 - SiO_2 - SnO_2.$

Fig. 5. Concentration-strength acid site distribution on $ZrSi_2Sn_{0.4}$ and $ZrSi_2$ surface. $\square - ZrO_2 - SiO_2$; $\square - ZrO_2 - SiO_2 - SnO_2$.

Рис. 6. Спектри термопрограмованої реакції утворення Mbyne (66 а.о.м) (крива *1*) та Prenal (84 а.о.м) (крива 2) з МБОН (69 а.о.м) (крива *3*), адсорбованого на ZrSi₂Sn_{0.4}.

Fig. 6. Thermoprogrammed reaction spectra of formation Mbyne (m/e = 66) (curve 1) and Prenal (m/e = 84) (curve 2) with MBOH (m/e = 69) (curve 3), adsorbed on $ZrSi_2Sn_{0.4}$.

Смуги поглинання при 206 та 220 nm (рис. 7) у спектрах зразків ZrSi₂Sn_x з $x \le 1$ вказують на присутність ізольованих тетраедрично та октаедрично координованих йонів Sn⁴⁺ у матриці ZrO₂–SiO₂, які відносять до бренстедівських та

льюїсівских кислотних центрів [19]. Центрами Бренстеда можуть бути місткові – ОН групи на катіонах ^{VIII}Zr⁴⁺ та ^{IV}Sn⁴⁺ [16]. У спектрах зразків з Sn⁴⁺ \geq 2 спостерігається плече при 250...300 nm (рис. 7). Очевидно, що подальше зростання вмісту олова призводить до пріоритетного формування зв'язку Sn–O–Sn, яке завершується утворенням окремої фази SnO₂ для зразка ZrSi₂Sn₄.



Стан поверхні синтезованих зразків вивчали також методом рентгенівської фотоелектронної спектроскопії. Відповідні значення енергій зв'язку (E_b), які узгоджуються з теоретичними та експериментальними [20–24], наведені в табл. 2. Спектри Zr 3*d*-рівнів розкладали на зв'язані пари компонент з параметрами ΔE_b (3 $d_{3/2}$ – $-3d_{5/2}$) = 2,4 eV, $I_{3d_{3/2}}/I_{3d_{5/2}}$ = 0,72, FWHM = 2 eV (рис. 8). Домінувала компонента із E_b = 182,8 nm, яку можна віднести до Zr⁴⁺ станів зв'язку Sn–O–Zr–O–Si в ZrSi₂Sn_{0,4}. Спектральна особливість в області 183,4 eV відповідає Zr⁴⁺ станам зв'язку Zr–O––Si в ZrO₂–SiO₂, що узгоджується з результатами для ZrSiO₄ [21]. Компонента з E_b = 182,1 eV відповідає Zr⁴⁺ в ZrO₂ [20, 21, 23, 24], що збігається з максимумом Zr3d_{5/2} лінії реперного зразка ZrO₂.

Таблиця 2. Значення енергій зв'язку (*E_b*) рівнів 3*d*, Si 2*p* Zr i 3*d* Sn в ZrSi₂Sn_{0,4}, ZrSi₂, ZrO₂, SiO₂ та SnO₂

D m/		Zr 3 <i>d</i> _{5/2}	Si 2p	Sn 3d _{5/2}		
зразок		E_b , eV				
ZrSi Sn	Zr–O–Zr	182,1				
	Sn-O-Zr-O-Si	182,8	102.0	487,3		
21312311	Zr–O–Si	183,4	102,9			
	Zr–O–Sn	184,4				
7:5:	Zr–O–Si	183,4	102.7	_		
21312	Zr–O–Zr	182,3	102,7			
ZrO ₂	-	182,2	-	-		
SiO ₂	_	_	103,4	_		
SnO ₂	_	_	-	486,7		

Максимуми Zr $3d_{5/2}$ i Sn $3d_{5/2}$ рівнів, що відповідають Zr⁴⁺ та Sn⁴⁺ у Zr–O–Sn– O–Si зв'язках ZrSi₂Sn_{0,4} (182,8 та 487,3 eV), зсунуті у бік вищих енергій зв'язку порівняно з енергією вихідних діоксидів ZrO₂ i SnO₂ (182,2 та 486,7 eV) (табл. 2). Водночас, РФ-спектри внутрішніх Si 2*p*-електронів зміщуються до нижчих енергій зв'язку в змішаних ZrSi₂ та ZrSi₂Sn_{0,4} оксидах. Подібний високоенергетичний зсув Zr $3d_{5/2}$ -рівня в РФ-спектрах спостерігали для циркону (ZrSiO₄) та ZrO₂– SiO₂–Al₂O₃ оксиду [21, 12]. Ці зсуви в спектрах зразка ZrSi₂Sn вказують на зміщення електронної густини від атомів цирконію та олова до атомів кремнію. Таким чином, надлишковий позитивний заряд на катіонах цирконію та олова на поверхні ZrO_2 – SiO_2 – SnO_2 оксиду може формувати суперкислотні центри Лью-їса ($H_0 > -12$):



Рис. 8. Рентгенівські фотоелектронні спектри Zr 3*d*-рівня для ZrSi₂Sn_{0,4} (*a*), ZrSi₂ (*b*) та ZrO₂(*c*). Fig. 8. X-ray photoelectron Zr spectra of the 3*d*-level for ZrSi₂Sn_{0,4} (*a*), ZrSi₂ (*b*) and ZrO₂(*c*).

висновки

Синтезовано потрійний ZrO₂-SiO₂-SnO₂ оксид та визначено вплив вмісту йонів олова на текстурні, структурні та кислотні перетворення в оксидній системі. Встановлено, що найвищі сила $(H_0 = -14,52)$ та концентрація ([HB] = = 1,5 mmole/g) кислотних центрів властиві зразку ZrSi₂Sn_{0,4}. За даними електронної спектроскопії дифузного відбиття та рентгенівської фотоелектронної спектроскопії запропоновано схему суперкислотного центра та виявлено, що суперкислотність ZrO2-SiO2-SnO2 оксиду пов'язана з утворенням координаційно ненасичених йонів Zr^{4+} та ${}^{IV}Sn^{4+}$ як сильних центрів Льюїса.



- Retention behavior of basic a solutes on zirconia-silica composite stationary phases up ports in normal phase liquid chromatography / R. A. Shalliker, M. Rizk, C. Stocksiek, A. P. Sweeney // J. of Liquid Chromatography and Related Techn. – 2002. – 2, № 4. – P. 561–572. https://doi.org/10.1081/JLC-120008811
- Sorption mechanism for Cs⁺, Co₂⁺ and Eu₃⁺ on amorphous zirconium silicate as cation exchanger / I. M. El-Naggar, E. A. Mowafy, Y. F. El-Aryan, M. G. Abd El-Wahed // Solid State Ionics. 2007. **178**. P. 741–747. https://doi.org/10.1016/j.ssi.2007.03.009
- New industrial process of PTMG catalyzed by solid acid / T. Setoyama, M. Kobayashi, Y. Kabata, T. Kawai, and A. Nakanishi // Catalysis Today. 2002. 73. P. 29–37. https://doi.org/10.1016/S0920-5861(01)00515-6
- Prudius S. V. Synthesis of mesoporous acid oxides ZrO₂-SiO₂ // Catalysis and Petrochemistry. - 2010. - 18. - P. 1-5.
- Hammett acidity function for mixed ZrO₂-SiO₂ oxide at elevated temperatures / E. I. Inshina, D. V. Shistka, G. M. Telbiz, and V. V. Brei // Chemistry, Physics and Techn. of Surf. - 2012. - 3, № 4. - P. 395-400.
- Tarafdar A., Panda A. B., and Pramanik P. Synthesis of ZrO₂–SiO₂ mesocomposite with high ZrO₂ content via a novel sol–gel method // Microporous and Mesoporous Mat. – 2005.
 - 84. – P. 223–228. https://doi.org/10.1016/j.micromeso.2005.05.014
- Inshina E. I. and Brei V. V. Acylation of methyl tert-butyl ether by acetic anhydride on acid Amberlist-15 and ZrO₂-SiO₂ Catalysts // Theoretical and Experimental Chemistry. – 2013.

- **49**, № 5. - P. 320–325. https://doi.org/10.1007/s11237-013-9332-8

- Inshina O. I., Sharanda M. E., and Brei V. V. Transetherification of methyl tert-butyl ether with ethanol over acidic ZrO₂–SiO₂ oxide and Dowex DR-2030 sulphoresin catalyst // Catalysis and Petrochemistry. – 2014. – 23. – P. 5–7.
- Патент Україна (2016) № U 2016 04724, B01J29/08; B01J37/00; C10G11/00, 11/05. Спосіб одержання цирконій силікатного каталізатора крекінгу вакуумного газойлю / В. В. Брей, С. В. Прудіус, О. І. Іньшина, К. М. Хоменко. – Заявл. 28.04.2016.
- Vasanthavel S., Derby B., and Kannan S. Stabilization of a t-ZrO₂ polymorph in a glassy SiO₂ matrix at elevated temperatures accomplished by ceria additions // Dalton Transaction. - 2017. - 46. - P. 6884–6893.
- Nanosized TiO₂-based mixed oxide films: sol-gel synthesis, structure, electrochemical characteristics and photocatalytic activity / N. Smirnova, Y. Gnatyuk, N. Vityuk, O. Linnik, A. Eremenko, V. Vorobets, and G. Kolbasov // Int. J. of Mat. Eng. 3, № 6. P. 124–135. doi: 10.5923/j.ijme.20130306.02
- Synthesis and study of superacid ZrO₂–SiO₂–Al₂O₃ mixed oxide / O. Inshina, A. Korduban, G. Tel'biz, and V. Brei // Adsorption Sci. Techn. – 2017. – 35. – P. 439–447. doi.org/10.1177/0263617417694887
- Sythesis and research of new superacid ZrO₂-SiO₂-SnO₂ oxide / S. V. Prudius, N. L. Hes, V. V. Trachevskiy, and V. V. Brei // Dopovidi Nacionalnoi akademii nauk Ukraini. – 2019. – 11. – P. 73–80.
- Systematic synthesis and analysis of change in morphology, electronic structure and photoluminescence properties of pyrazine intercalated MoO₃ hybrid nanostructures / S. Rajagopal, D. Nataraj, O. Y. Khyzhun, Y. Djaoued, J. Robichaud, K. Senthil, and D. Mangalaraj // Cryst. Eng. Comm. – 2011. – 13, № 7. – P. 2358–2368. doi: 10.1039/C0CE00303D
- Photocatalytic properties of tin dioxide doped with chromium(III), silver and zinc compounds in the oxidation of organic substrates by the action of visible light / S. V. Khalameida, M. N. Samsonenko, V. V. Sydorchuk, V. L. Starchevskyy, O. I. Zakutevskyy, and O. Y. Khyzhun // Theoretical and Experimental Chemistry. 2017. 53, № 1. P. 40–46. doi: 10.1007/s11237-017-9499-5
- New Solid Acids and Bases: Their Catalytic Properties / K. Tanabe, M. Misono, Y. Ono, and H. Hattoni. – Amsterdam: Elsevier, 1989. – 365 p.
- 17. *Brei V. V.* Correlation between the strength of the basic sites of catalysts and their activity in the decomposition of 2-methyl–3-butyn–2-ol as a test reaction // Theoretical and Experimental Chem. 2008. **44**, № 5. P. 320–324. https://doi.org/10.1007/s11237-008-9040-y
- Effect of microwave assisted and conventional thermal heating on the evolution of nanostructured inorganic–organic hybrid materials to binary ZrO₂–SiO₂ oxides / S. Mascotto, O. Tsetsgee, K. Mu⁻Iler, C. Maccato, B. Smarsly, D. Brandhuber, E. Tondello, and S. Gross // J. of Mat. Chem. – 2007. – 17. – P. 4331–4342.
- Mesoporous tin oxide: An efficient catalyst with versatile applications in acid and oxidation catalysis / P. Manjunathan, V. S. Marakatti, P. Chandra, A. B. Kulal, Sh. B. Umbarkar, R. Ravishankar, and G. V. Shanbhag // Catalysis Today. – 2018. – 309, № 1. – P. 61–76. https://doi.org/10.1016/j.cattod.2017.10.009
- Handbook of X-ray Photoelectron Spectroscopy / C. D. Wagner, W. M. Riggs, L. E. Davis, J. F. Moulder, and G. E. Muilenberg. – Eden Prairie, MN, USA: Perkin-Elmer Co., Physical Electronics Division, 1979.
- Guittet M. J., Crocombette J. P., and Gautier Soyer M. Bonding and XPS chemical shifts in ZrSiO4 versus SiO₂ and ZrO₂: Charge transfer and electrostatic effects // Phys. Rev. B. - 2001. - 63, № 12. - P. 117-125.
- 22. Barr T. L. and Lishka M. A. ESCA studies of the surface chemistry of zeolites // J. Am. Chem. Soc. 1986. **108**, № 12. P. 3178–3186.
- Using photoelectron spectroscopy to observe oxygen spillover to zirconia / P. Lackner, Z. Zou, S. Mayr, U. Diebold, and M. Schmid // Physical Chemistry Chemical Physics. - 2019. - 21, № 32. - P. 17613-17620.
- 24. Ultrafast proton-assisted tunneling through ZrO₂ in dye-sensitized SnO₂-core/ZrO₂-shell films / J. R. Swierk, N. S. McCool, J. A. Röhr, S. Hedström, S. J. Konezny, C. T. Nemes, X. Pengtao, V. S. Batista, T. E. Mallouk, and C. A. Schmuttenmaer // Chemical Communications. 2018. 54, № 57. P. 7971–7974.